

経済産業大臣
世 耕 弘 成 殿

一般社団法人日本半導体製造装置協会
会 長 辻 村 学

税制改正に関する要望書

わが国の経済は、2012 年 12 月の安倍政権発足以来のアベノミクス推進のもと、緩やかながらも回復基調が続いています。円安・株高による、企業収益・消費マインドの改善も持続しており、日本経済には好循環が広がりつつあります。一方、世界経済は、米国トランプ政権の大型財政出動による先進国経済の牽引や資源価格半転による新興国経済の復調が期待されていますが、英国のEU離脱の悪影響や中東・北朝鮮等の地政学リスク、及びトランプ政権の米国優先政策による他国への反動の懸念も続いており、先行きの不透明感が増しております。また、IT・エレクトロニクス業界を取り巻く環境は、IoTやビッグデータ、AI、ロボット等に代表される第4次産業革命が急速に進んでおり、ビジネスモデルや社会構造が急速に変化しています。こうしたなか、長引くデフレから脱却し、景気回復を持続させ、日本経済を持続的な好循環軌道に乗せる為には、国内に立地する日本企業が海外企業とのグローバル競争に勝ち抜く事が重要です。海外企業との熾烈な競争を戦う中、円高の改善や法人実効税率の引下げの改善はみられますが、研究開発投資や先端設備投資に対する税制については諸外国との格差が大きく公平な競争環境にあるとは言えません。

本年6月に閣議決定された『未来投資戦略2017』における基本的考え方の中でも、「経済の好循環は着実に拡大しているが、民間の動きはいまだ力強さを欠いている。この原因は先進国に共通する長期停滞であり、この長期停滞を打破し、中長期的な成長を実現していく鍵は、近年急激に起きてきている第4次産業革命（IoT・ビッグデータ・AI、ロボット、シェアリングエコノミー等）のイノベーションを、あらゆる産業や社会生活に取り入れることにより、様々な社会課題を解決する「Society 5.0」を実現することにある」と提唱されました。このように新しい価値やサービスが次々と創出され、社会の主体たる人々に豊かさをもたらしていく人類史上5番目の新しい社会の実現が予感されておりますが、これらを推進する中心役がICT産業の進化であります。半導体・液晶パネル製造装置産業は、ICT産業を支える基盤産業であるとともに、世界のシェアは3割強と大きな割合を占めており、我が国にとっても重要な産業であります。また、当業界は技術革新進歩が著しい産業であり、日本企業がグローバル競争に打ち勝つためには、絶え間ない最先端技術の研究・開発によるイノベーションの創出が必要不可欠です。当業界では、イノベーションを生み出すために多大な研究開発投資を継続してきました。これを裏付けるように半導体・液晶パネル製造装置産業の売上高研究開発費率は約10.1%^{*1}と、製造業平均の4.90%^{*2}、全産業平均の4.13%^{*2}の約2~3倍と非常に高く

なっています。

このような研究開発活動を更に促進させ、イノベーション創出を促し、海外企業との熾烈なグローバル競争を勝ち抜くためには、税制面の整備・支援によるビジネス環境のイコールフットィング化が必要不可欠です。

「未来投資戦略2017」や「超スマート社会（Society 5.0）の実現」の成長戦略を更に推進するためにも、次に掲げる税制の整備を強く要望します。

※1 当協会の2017年6月調査によるSEAJ会員企業主要15社の2012～2016年度の5年間の平均

※2 出所：経済産業省「平成28年企業活動基本調査確報（平成27年度実績）」

1. 研究開発促進税制の拡充と見直し

既に述べたとおり、半導体・液晶パネル製造装置産業の売上高研究開発費率は10.1%^{※1}と、国内他産業と比較して約2～3倍もの研究開発費を投じています。海外競合企業の売上高研究開発費率も15.7%^{※3}となっており研究開発費比率が非常に高い産業と言えます。

半導体・液晶パネル製造装置産業が支える、半導体及び液晶パネル、それらを用いたIT・エレクトロニクス産業は「第4次産業革命（IoT・ビッグデータ・AI）」を推進する重要な産業であり、日本の他産業の発展にも大きな影響を及ぼしています。

当産業の研究開発費は、半導体や液晶パネルのさらなる微細化・高精細化、ウエハやガラスプレート基板の大型化等のニーズに応えるために一層巨額となってゆく傾向にあります。こうした状況下において、当産業が必要十分な研究開発費を投じて成長し、同時に他産業の発展を促進してゆくことは、わが国が注力すべき次の課題に照らしても必須と考えます。

- ①IoT、ビッグデータ、AIの活用によるものづくり革命「第4次産業革命」の推進
- ②次世代自動車、次世代交通システム、先端ロボット、IT機器、次世代デバイス等の最先端の製品の競争力向上
- ③低消費電力化やスマートグリッド等によるグリーン・イノベーションの推進
- ④先進的医療機器、医療のデジタル革命、医療・健康データ活用による世界最先端の健康立国の実現
- ⑤国民・社会を守る世界最高水準の通信インフラの整備
- ⑥イノベーション創出・チャレンジ精神に溢れる人材の創出による技術立国・知財立国日本の再興

こうした当産業における研究開発費の状況とその果たす役割を踏まえて、次の措置を要望します。

※3 当協会の2017年6月調査による海外競合企業主要5社の2012～2016年度の5年間の平均

(1) 試験研究費の税額控除割合の拡大及び税額控除限度額の廃止

当産業の研究開発費が多額であること、それによってもたらされる産業全体の成長とイノベーションが国益にもたらす影響を踏まえ、現在の試験研究費の総額

に係る税額控除制度における税額控除割合（現行は試験研究費割合の8～10%が限度、平成29年度改正では試験研究費の増減に応じて6～14%が限度となっており本制度の改正は必ずしも有利な改正になっていない可能性がある）の拡大と、控除限度額（現行はオープンイノベーション型5%を含め法人税額の30%、平成29年度改正では高水準型を含めた40%が限度）の廃止を要望します。

尚、当産業の税額控除限度額の切捨て額は194億円^{※4}と大きな額となっており、これは当産業の法人税額852億円^{※5}の約23%相当額となります。

※4 当協会の2017年6月調査によるSEAJ会員企業主要13社の2012～2016年度の5年間の平均

※5 当協会の2017年6月調査によるSEAJ会員企業主要13社の2012～2016年度の5年間の平均

(2) 繰越税額控除限度超過額等の繰越期間の復活及び繰越税額控除要件の廃止

当産業の業績は、顧客である半導体・液晶パネルメーカーの急激な投資動向の変化による振れ幅が大きく、かつそのサイクルも長期にわたるケースが多くあります。そうした特徴から、試験研究費について繰越税額控除限度超過額がある場合、繰越控除が1年間に限ってのみ認められていましたが平成27年度より本制度が廃止されました。また、廃止前の制度でさえ当該事業年度に所得がないために本制度による恩恵を受けられないケースが生じていました。

従って、まずは本制度の復活を要望します。加えて、諸外国の同制度が主に3年～無期限であることに鑑み、繰越税額控除限度超過額等の繰越期間を無期限とし、併せて繰越税額控除限度超過額の繰越控除を行う際の「当事業年度の試験研究費の額が前事業年度を上回る場合に限り」という従来の要件は廃止することを要望します。

(3) イノベーションボックス税制の創設

研究開発の成果である特許などの知的財産に基づく所得を減税対象とするイノベーションボックス税制が欧州を中心に普及し始めています。

既にEUにおいては、英国、オランダ、フランス等7カ国が、アジアにおいては中国がイノベーションの促進及び競争力向上を目的として、研究開発の成果である知的財産権から生じる所得に対する税率を優遇するイノベーションボックスまたはパテントボックス税制を導入しています。

一例として本税制を積極的に導入・推進するオランダでは、2004年に29.0%であった法人税率を2011年までに段階的に25.0%に引き下げる措置と併せて、2010年に従来のパテントボックス税制をイノベーションボックス税制へと拡大しています。これにより、研究開発活動による知的財産から生じた所得については法人税の計算上5%の軽減税率の適用を選択することを可能としています。

同国に本社を置く半導体製造装置のメーカーであるASML社の2012年度から2016年度の法人税率は平均7.0%と極めて低く^{※6}、イノベーションボックス税制の恩恵を最大限受けております。

海外企業と同じビジネス環境で熾烈な競争を戦えるよう、わが国においてもイノベーションボックス税制をできる限り早期に導入することを要望します。

2. 法人実効税率の引下げ

わが国の法人実効税率は、平成 28 年度税制改正により平成 27 年度の 33.06%から、平成 28 年度及び平成 29 年度は 30.86%、平成 30 年度以降は 30.62%へ引き下げられました^{※7}、依然として欧州及びアジア諸国に比べて高い水準にあります。同程度の水準である米国においても、トランプ大統領が法人税の最高税率を 35%から 15%に大幅に引き下げる事を検討していると表明しています。

特にわが国と事業及び立地において競争関係にあるアジア諸国と比較すると、中国 25%、韓国 24.2%、シンガポール及び台湾 17%と 5～10%以上の乖離があり、日本の企業競争力及び立地競争力低下の大きな要因になっており、世界で戦う日本企業が継続的に存続することは困難です。

立地競争力強化のためには、空港・港湾等の産業インフラの整備、金融・資本市場の活性化、雇用制度の改革、人材強化等の総合的な施策が必要ですが、法人実効税率の引き下げの果たす役割は特に重要です。

従って、現在懸念されている「根こそぎ空洞化」を防止するに留まらず、より積極的に海外の成長力ある企業がわが国を拠点とした事業活動を行うことを希求する水準への思い切った引き下げが必要です。

具体的には、法人実効税率をアジア諸国と競争力のある水準である 20%前半まで、3 年以内に引き下げることがを要望します。

※7 超過税率適用法人の場合（東京都の超過税率で算定した税率）

3. 欠損金の繰越控除限度額及び繰越期間の見直し

平成 24 年度から中小法人等以外の法人については欠損金の繰越控除が欠損金控除前課税所得の 80%に制限され、併せて欠損金の繰越期間が 7 年から 9 年へと延長されました。

更に平成 27 年度、28 年度税制改正により、平成 30 年以降は繰越期間が 10 年延長されたものの、控除限度割合は 50%に制限されたため、本制度全体としては縮小方向での改正となっております。

先に述べたように当産業は、顧客である半導体・液晶パネルメーカーの投資動向による業績の振幅が大きく、かつその回復までのサイクルが長期にわたるケースが多いため、現在の繰越欠損金の取り扱いでは不十分なケースも見受けられます。

また、わが国の欠損金に関する制度は、諸外国に比べて見劣りのするものであり、さらに、近年の税制改正を経てその差は拡大している状況で、とりわけ当産業において苦境にありながらも業績回復に注力する企業にとって障害となっています。

諸外国に比べ不利な条件である繰越控除額の制限を廃止すると共に、繰越期間を無期限とするよう要望します。

4. 設備投資に関する減税及び資産課税制度の見直し

(1) 設備投資に関する減税

当産業では、半導体・液晶パネルの微細化やウエハ・基板の大型化に対応するために多額かつ継続的な設備投資が必要であり、また、当産業の顧客である半導体及び液晶パネルメーカーも、より付加価値の高いデバイスを製造していくための設備投資が不可欠なものとなっています。

海外企業との熾烈な競争の中にある国内の半導体・液晶パネル製造装置産業、半導体・液晶パネル産業および半導体関連電子製品産業が、世界最高レベルの技術水準を維持し、かつグリーン・イノベーションの推進にも貢献していくために、生産性向上設備投資促進税制など、設備投資の目的に配慮した税制の継続・復活を要望します。

(2) 固定資産税（償却資産）の見直し

同様の趣旨から、わが国の償却資産に関わる固定資産税が国際的に見ても希な制度（特に当業界にとって競争が著しい韓国、中国には当制度は存在しない）であることを踏まえ、その速やかな縮減・廃止を要望します。

5. 国際関連税制の見直し

(1) 移転価格税制の改善

平成 29 年度税制改正大綱の「中期的に取り組むべき事項」の中で、無形資産取引に係る所得相応性基準の導入検討が挙げられておりましたが、これにより、無形資産取引に係る移転価格税制上の取扱いの明確化や見直し等が促進される事を期待します。その見直しに伴い、国際間の二重課税排除の措置についても同時に検討される事を要望します。

(2) 外国税額控除の条件緩和

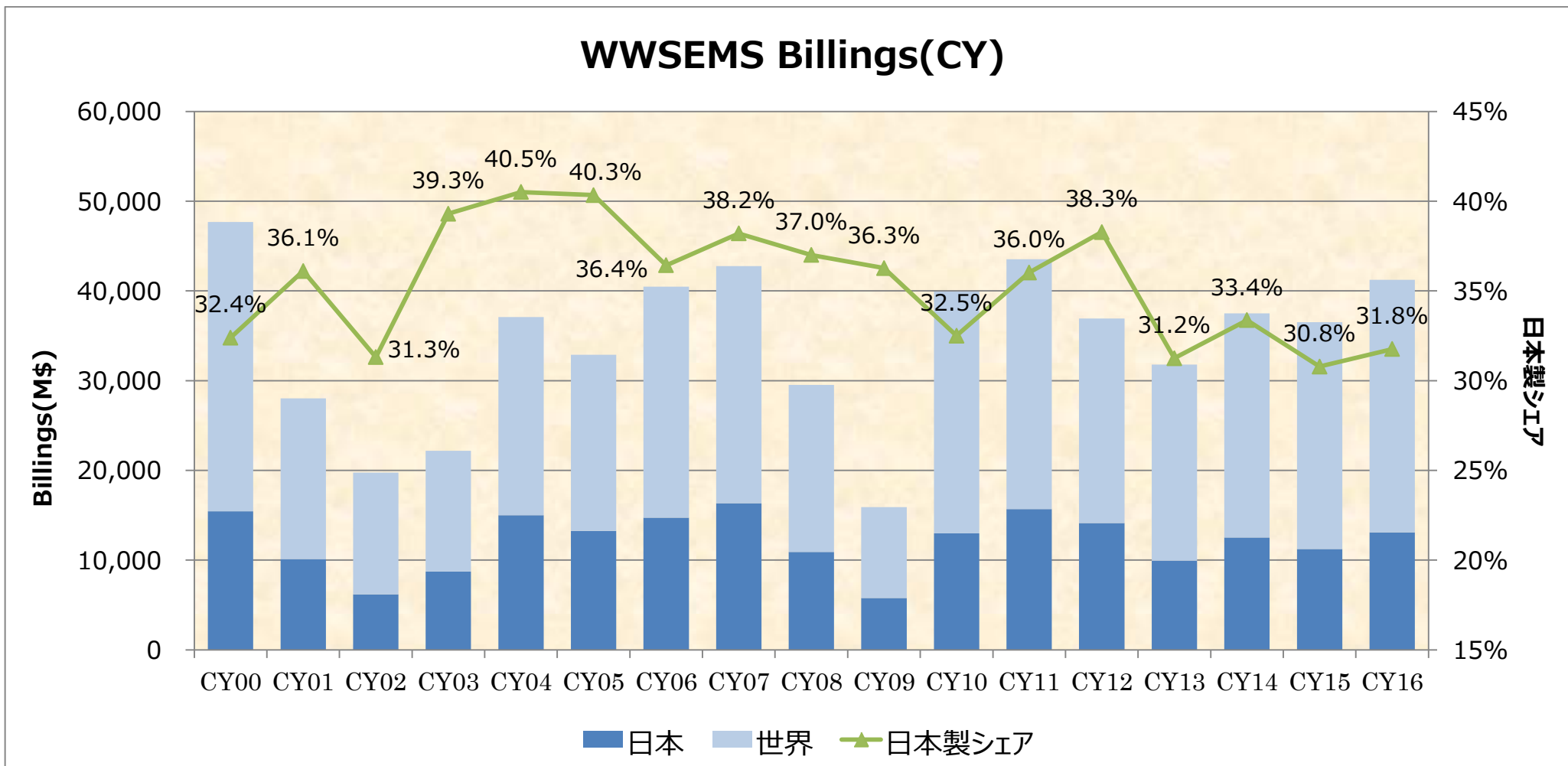
企業活動がグローバルに展開される中で、二重課税の排除は可能な限り許容されるべきであります。当産業の企業の多くは海外に現地法人を設立し当該国/地域で活動を展開しておりますが、技術進歩が速いため国内からの人員派遣や設備貸与が不可欠となっております。日本企業がこれらの活動を通して現地で得る役務所得や設備使用料等は現地で源泉徴収課税された後に、現地法人や顧客から回収されますが、これら外国での課税額についての日本での外国税額控除の条件を見直し緩和することにより、企業のグローバルな活動促進が期待されます。

現行税制で3年間となっている控除限度超過額と控除余裕額の繰越期間を延長するとともに、繰越期間経過後の控除限度超過額を損金算入可能とする条件緩和により、二重課税の排除が拡大されることを要望します。

以 上

< 添付資料 1 >

1. 半導体製造装置世界市場と日本製装置シェア推移

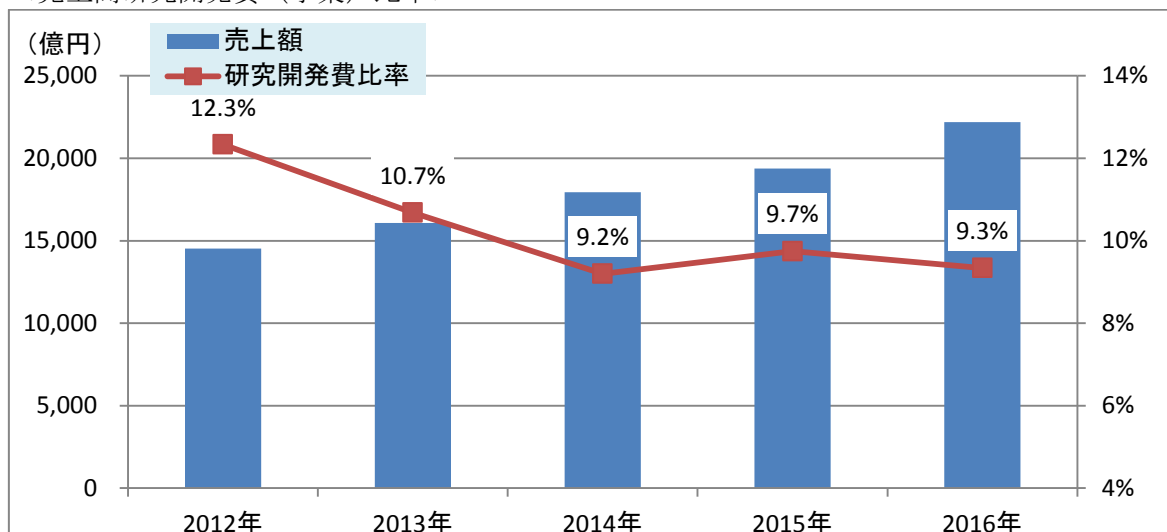


<添付資料 2>

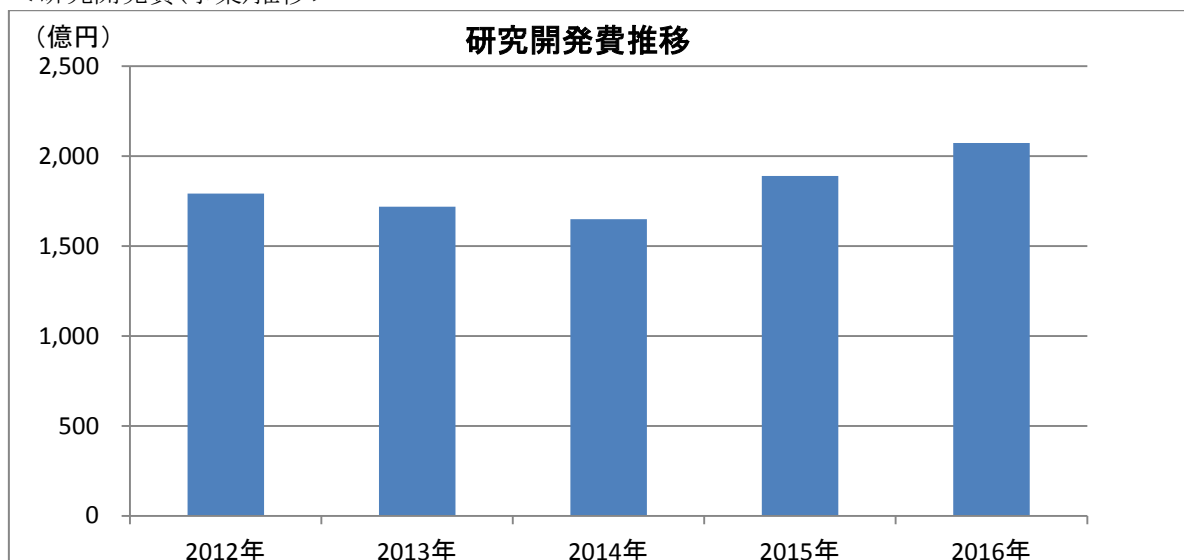
2. 売上高研究開発費(事業)及び、設備投資(事業)比率

1) SEAJ 会員企業 (主要 15 社合計)

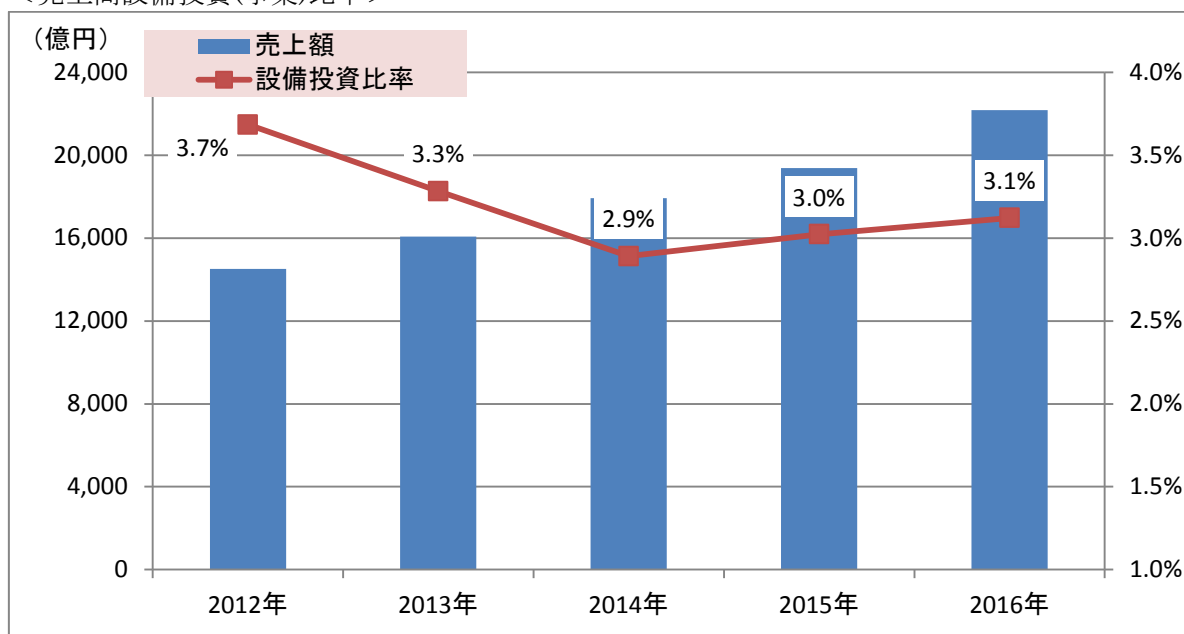
<売上高研究開発費 (事業) 比率>



<研究開発費(事業)推移>

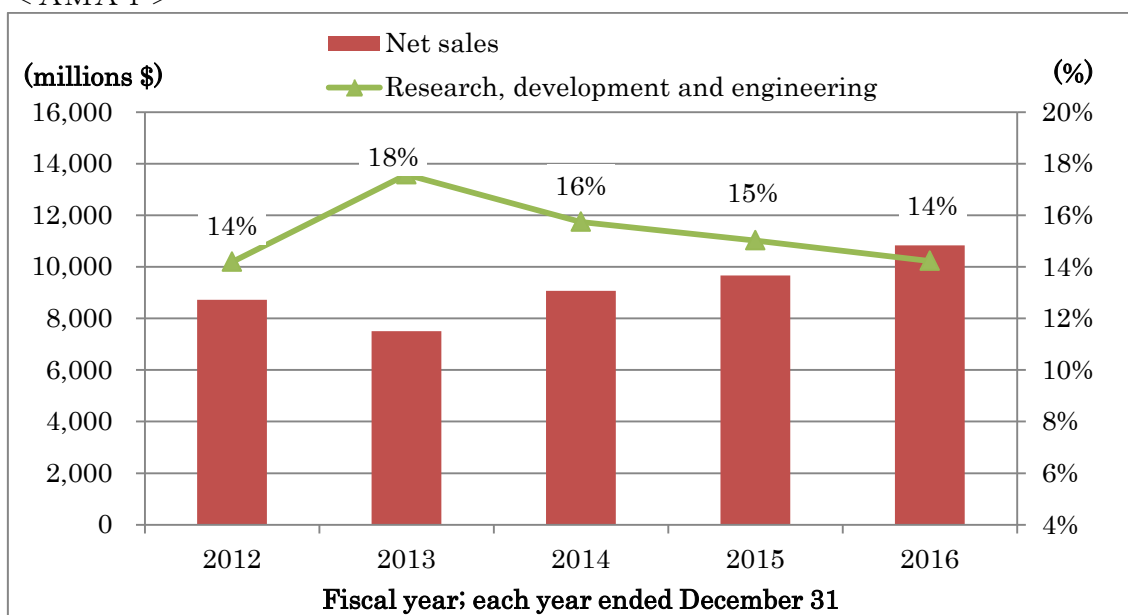


<売上高設備投資(事業)比率>

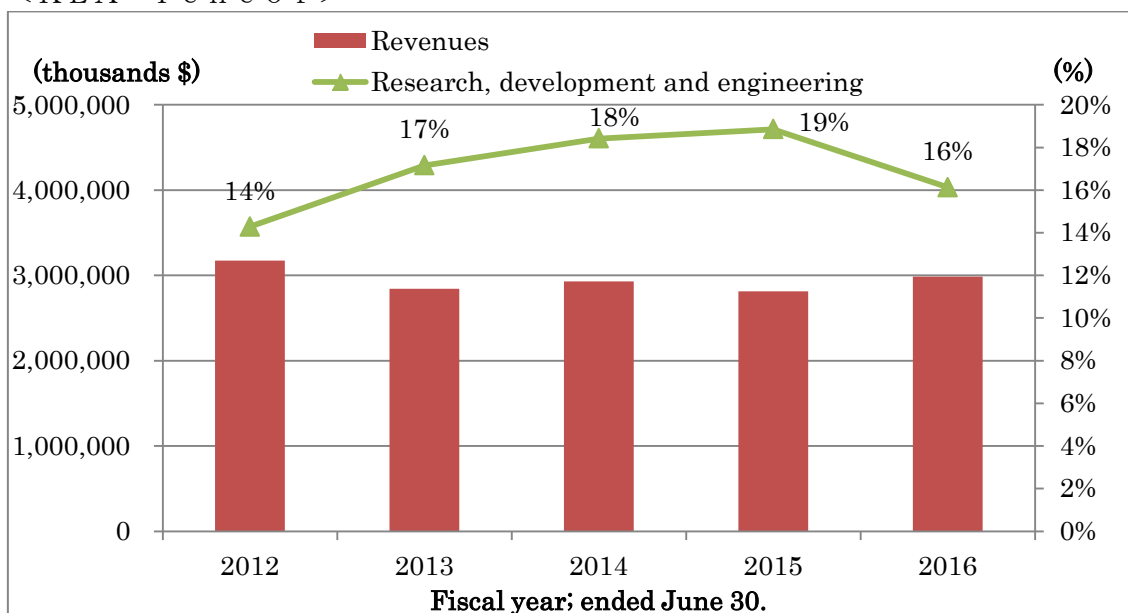


2) 海外競合企業 (売上高研究開発費比率)

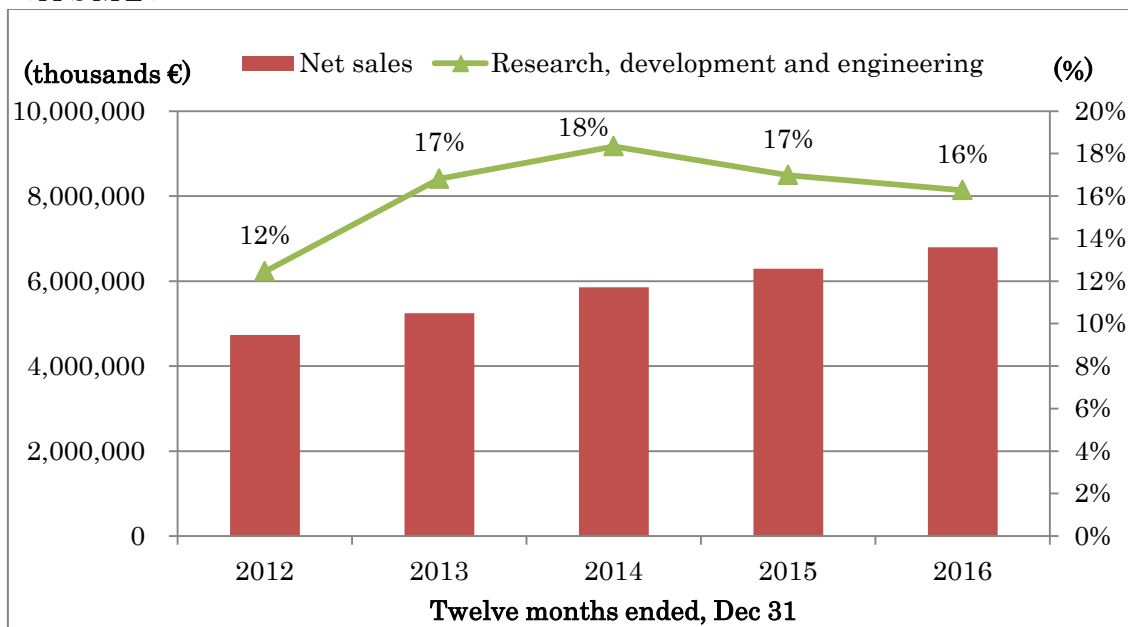
<AMAT>



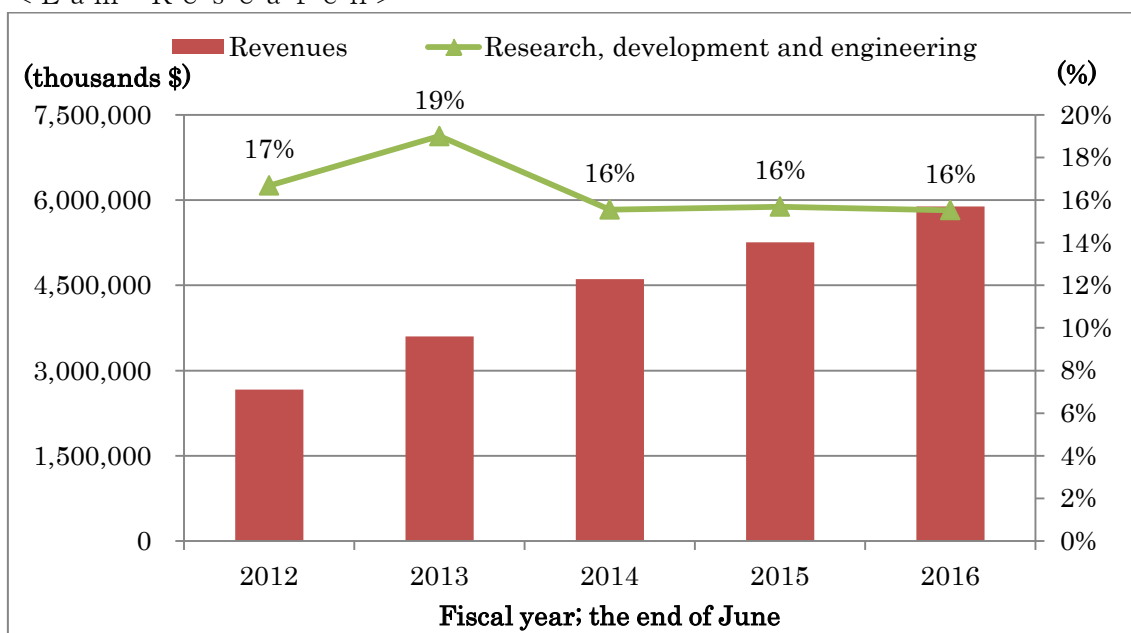
<KLA-Tencor>



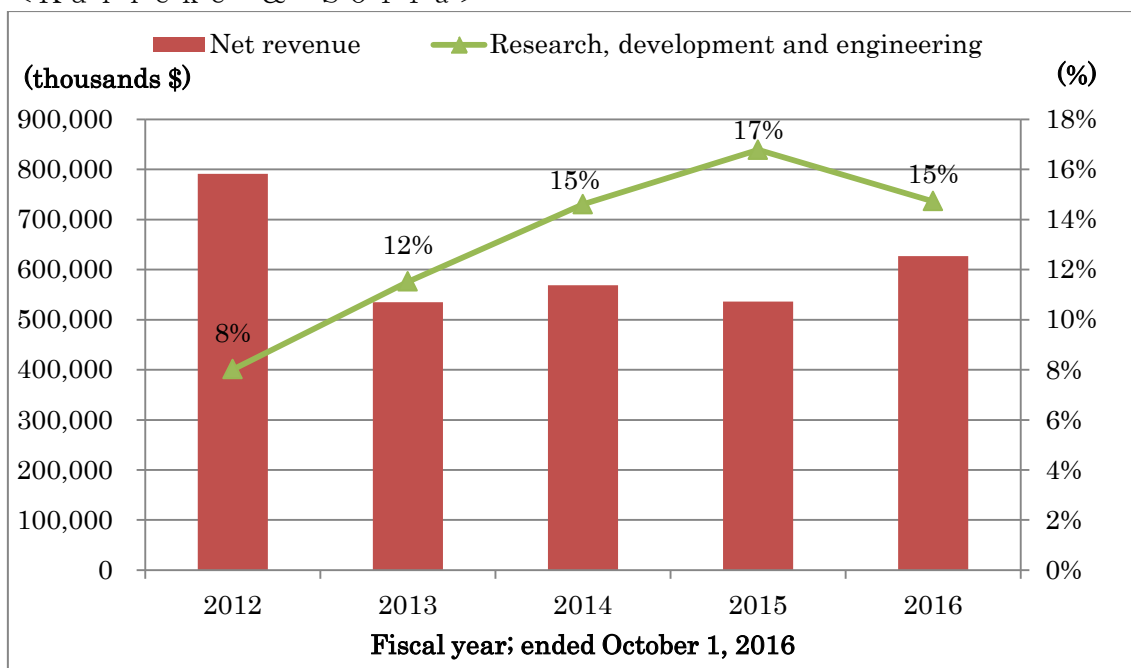
<ASML>



< L a m R e s e a r c h >



< K u l i c k e & S o f f a >



3) A S M L 社法人税率推移 (2012 年度～2016 年度 平均 7.0%)

ASML (€ in thousands)	2012	2013	2014	2015	2016
Net sales	4,731,555	5,245,326	5,856,277	6,287,375	6,794,752
Gross profit	2,005,257	2,177,262	2,596,374	2,895,744	3,044,480
R&D costs, net of credits	589,182	882,029	1,074,035	1,068,077	1,105,763
Selling, general and administrative	259,301	311,741	321,110	345,732	374,760
Income (loss) from operations	1,156,774	1,047,948	1,282,235	1,565,135	1,657,734
Income(loss) before income taxes	1,150,578	1,023,477	1,273,635	1,548,620	1,691,378
Provision for income taxes	4,262	7,987	76,995	161,446	219,484
Net income(loss)	1,146,316	1,015,490	1,196,640	1,387,174	1,471,894
法人税率	0.4%	0.8%	6.0%	10.4%	13.0%

4) AMAT 社法人税率推移 (2012 年度～2016 年度 平均 20.8%)

AMAT (millions \$)	2012	2013	2014	2015	2016
Net sales	8,719	7,509	9,072	9,659	10,825
Gross profit	3,313	2,991	3,843	3,952	4,511
R&D costs, net of credits	1,237	1,320	1,428	1,451	1,540
Selling, general and administrative	1,076	898	895	808	819
Income (loss) from operations	411	432	1,520	1,693	2,152
Income(loss) before income taxes	316	350	1,448	1,598	2,013
Provision for income taxes	207	94	376	221	292
Net income(loss)	109	256	1,072	1,377	1,721
法人税率	65.5%	26.9%	26.0%	13.8%	14.5%

5) 控除税枠切捨て額、繰越切捨て額 (SEAJ 会員企業主要 15 社合計)

(M¥)

	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
売上額(全社)	6,198,482	6,612,076	6,761,232	6,845,417	6,837,640
研究開発費(会計上)	532,821	528,565	531,136	564,928	558,154
研究開発費(税務上)	446,405	444,218	445,173	458,436	436,747
法人税額	69,659	84,848	89,618	92,924	88,717
控除税額	20,448	24,612	24,128	24,634	18,602
税枠切捨て額	20,274	21,692	16,341	18,804	20,063
増加型の適用「有」	3	5	5	6	8
増加型の適用「無」	9	9	9	8	5

(注) 上記表に記載されている税務上の研究開発費、法人税額など税務上に関わる数値は法人税の別表を基に記載してあります。

6) 日本主要産業別研究開発費

(出所：経済産業省「平成 28 年企業活動基本調査 (平成 27 年度実績)」)

	研究開発費 報告企業数	売上高 (億円)	研究開発費 (億円)	受託研究費 (億円)	売上高研究 開発費比率 (%)	1企業当たり(百万円)	
						売上高	研究開発費
合計	8,331	3,500,704	144,734	11,552	4.13	42,020.2	1,737.3
製造業	6,230	2,404,664	117,854	3,043	4.90	38,598.1	1,891.7
電気・ガス業	38	230,531	981	100	0.43	606,660.5	2,581.6
情報通信業	526	138,710	4,705	504	3.39	26,370.7	894.5
卸売業	1,040	607,423	12,465	235	2.05	58,406.1	1,198.6
小売業	148	33,634	144	0	0.43	22,725.7	97.3
サービス業(*)	115	21,631	261	8	1.21	18,809.6	227.0

7) 半導体・FPD・PVD 製造装置の設備投資額、償却資産残高推移及び生産性向上設備投資
促進税制活用推移

(M¥)

	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
設備投資額(事業)	53,498	52,814	51,859	58,610	69,273
償却資産残高 (機械設備等) ※2	179,011	165,664	166,430	154,494	159,285
即時償却、特別償却額	0	0	39	0	0
税額控除額	0	0	430	168	153